第227回フロンティア材料研究所講演会

次世代半導体デバイスを拓く新材料・薄膜技術

Advanced Materials and Thin-Film Technologies for Next-Generation Semiconductor Devices

日時： 2026年12月14日（月） 14:00～16:40
場所： 東京科学大学 横浜キャンパス R3棟1F会議室
主催： フロンティア材料研究所

プログラム

14:00～14:50
「次世代配線および配線層デバイス向け材料の開発」
金　美賢 先生
産業技術総合研究所エレクトロニクス・製造領域

14:50～15:40
「歪みを駆動力にした半導体デバイス向け新規材料技術」
畑山 祥吾 先生
産業技術総合研究所エレクトロニクス・製造領域

15:40～15:50 休憩

15:50～16:40
「シリコン系薄膜におけるフォノンドラッグ効果」
黒澤 昌志 先生
名古屋大学大学院工学研究科 物質科学専攻

[連絡先] 片瀬貴義 E-mail: katase.t.aa@m.titech.ac.jp, 内線5314